

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成 18 年 1 月 5 日 (2006.1.5)

【公表番号】特表 2002-510404 (P2002-510404A)

【公表日】平成 14 年 4 月 2 日 (2002.4.2)

【出願番号】特願 平 11-506671

【国際特許分類】

G 0 3 F 7/039 (2006.01)

C 0 8 F 12/24 (2006.01)

C 0 8 G 8/28 (2006.01)

【 F I 】

G 0 3 F 7/039

C 0 8 F 12/24

C 0 8 G 8/28 Z

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 7 月 1 日 (2005.7.1)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】補正の内容のとおり

【補正方法】変更

【補正の内容】

手 続 補 正 書

平成17年 7月 1日



特許庁長官殿

1. 事件の表示

平成11年特許願第506671号

2. 補正をする者

コダック ポリクローム グラフィックス カンパニー リミテッド

3. 代理人

東京都中央区八重洲2丁目3番1号

TEL 03(5288)5811

弁理士(6490) 志賀正

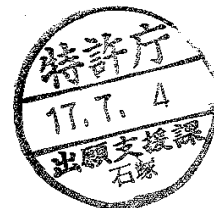


4. 補正対象書類名

(1) 明細書

5. 補正対象項目名

(1) 特許請求の範囲



6. 補正の内容

(1) 特許請求の範囲を別紙のとおり補正する。



特許請求の範囲

1. 基板上に所定のレジストパターンを作製する方法であって、当該方法は、前記基板を具備した前駆体であって、ポジ型作用組成物を具備するコーティングをその表面に有する前駆体に、赤外線をパターンの的に適用する工程、及び現像剤を使用して前記パターンを現像する工程

を具備し、

前記組成物は、その表面に官能基Qを有するポリマー物質を具備し、

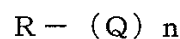
前記官能化されたポリマー物質は、赤外線照射前は現像剤に不溶性であり、その後は現像剤可溶性である性質を有し、

前記官能基Qは、二アジ化ナフトキノン基も、二アジ化ベンゾキノン基も具備せず、

前記官能基Qは、アミノ基、モノアルキルアミノ基、ジアルキルアミノ基、アミド基、モノアルキルアミド基、ジアルキルアミド基、クロロ基、フルオロ基、カルボニル基、スルフィニル基、又はスルホニル基を具備する基より選択され、

または、

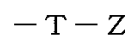
前記官能基化されたポリマー物質が、式



〔式中、

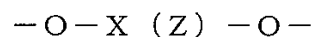
Rは当該ポリマー物質のポリマー鎖を表し、(Q) n は、それに結合している官能基を表し、

Qは、式



〔式中、

Tは、式



(式中、

Xは連結部分を表し；

Zは同じ分子又は隣接した一又は複数の分子のポリマー鎖Rに適宜水素結合して

いる部分である)

の基を表す}

の基を表す} で定義される

ことを特徴とする方法。

2. 基板上に所定のレジストパターンを作製する方法であって、当該方法は、
前記基板を具備した前駆体であって、ポジ型作用組成物を具備するコーティング
をその表面に有する前駆体に、赤外線をパターンの的に適用する工程、及び
現像剤を使用して前記パターンを現像する工程
を具備し、
前記組成物は、その表面に官能基Qを有するポリマー物質を具備し、
前記官能化されたポリマー物質は、赤外線照射前は現像剤に不溶性であり、その
後は現像剤可溶性である性質を有し、
前記官能基Qは、二アジ化ナフトキノン基も、二アジ化ベンゾキノン基も具備せ
ず、
前記官能基Qは、アミノ基、モノアルキルアミノ基、ジアルキルアミノ基、アミ
ド基、モノアルキルアミド基、ジアルキルアミド基、クロロ基、フルオロ基、カ
ルボニル基、スルフィニル基、又はスルホニル基を具備する基より選択され、
または、
前記官能基化されたポリマー物質が、フェノール樹脂、又はヒドロキシスチレン
のポリマー若しくはコポリマーより選択される
ことを特徴とする方法。

3. 基板を具備した前駆体であって、ポジ型作用組成物を具備するコーティ
ングをその表面に有する前駆体に、赤外線をパターンの的に適用する工程、及び
現像剤を使用して前記パターンを現像する工程
を具備する、基板上に所定のレジストパターンを作製する方法に使用されるポジ
型前駆体であって、
前記組成物は、その表面に官能基Qを有するポリマー物質を具備し、

前記官能化されたポリマー物質は、赤外線照射前は現像剤に不溶性であり、その後は現像剤可溶性である性質を有し、

前記官能基Qは、二アジ化ナフトキノン基も、二アジ化ベンゾキノン基も具備せず、

前記官能基Qは、アミノ基、モノアルキルアミノ基、ジアルキルアミノ基、アミド基、モノアルキルアミド基、ジアルキルアミド基、クロロ基、フルオロ基、カルボニル基、スルフィニル基、又はスルホニル基を具備する基より選択されることを特徴とするポジ型前駆体。

4. 基板を具備した前駆体であって、ポジ型作用組成物を具備するコーティングをその表面に有する前駆体に、赤外線をパターンの的に適用する工程、及び現像剤を使用して前記パターンを現像する工程

を具備する、基板上に所定のレジストパターンを作製する方法の適用によって製造される画像付き物品であって、

前記組成物は、その表面に官能基Qを有するポリマー物質を具備し、

前記官能化されたポリマー物質は、赤外線照射前は現像剤に不溶性であり、その後は現像剤可溶性である性質を有し、

前記官能基Qは、二アジ化ナフトキノン基も、二アジ化ベンゾキノン基も具備せず、

前記官能基Qは、アミノ基、モノアルキルアミノ基、ジアルキルアミノ基、アミド基、モノアルキルアミド基、ジアルキルアミド基、クロロ基、フルオロ基、カルボニル基、スルフィニル基、又はスルホニル基を具備する基より選択されることを特徴とする画像付き物品。

5. 基板を具備した前駆体であって、ポジ型作用組成物を具備するコーティングをその表面に有する前駆体に、赤外線をパターンの的に適用する工程、及び現像剤を使用して前記パターンを現像する工程

を具備する、基板上に所定のレジストパターンを作製する方法の適用によって製造される印刷版であって、

前記組成物は、その表面に官能基Qを有するポリマー物質を具備し、
前記官能化されたポリマー物質は、赤外線照射前は現像剤に不溶性であり、その
後は現像剤可溶性である性質を有し、
前記官能基Qは、二アジ化ナフトキノン基も、二アジ化ベンゾキノン基も具備せ
ず、
前記官能基Qは、アミノ基、モノアルキルアミノ基、ジアルキルアミノ基、アミ
ド基、モノアルキルアミド基、ジアルキルアミド基、クロロ基、フルオロ基、カ
ルボニル基、スルフィニル基、又はスルホニル基を具備する基より選択されるこ
とを特徴とする印刷版。

6. 基板を具備した前駆体であって、ポジ型作用組成物を具備するコーティ
ングをその表面に有する前駆体に、赤外線をパターン的に適用する工程、及び
現像剤を使用して前記パターンを現像する工程
を具備する、基板上に所定のレジストパターンを作製する方法の適用によって製
造される電子パーツ又はマスクであって、
前記組成物は、その表面に官能基Qを有するポリマー物質を具備し、
前記官能化されたポリマー物質は、赤外線照射前は現像剤に不溶性であり、その
後は現像剤可溶性である性質を有し、
前記官能基Qは、二アジ化ナフトキノン基も、二アジ化ベンゾキノン基も具備せ
ず、
前記官能基Qは、アミノ基、モノアルキルアミノ基、ジアルキルアミノ基、アミ
ド基、モノアルキルアミド基、ジアルキルアミド基、クロロ基、フルオロ基、カ
ルボニル基、スルフィニル基、又はスルホニル基を具備する基より選択されるこ
とを特徴とする電子パーツ又はマスク。

7. 基板を具備した前駆体であって、ポジ型作用組成物を具備するコーティ
ングをその表面に有する前駆体に、赤外線をパターン的に適用する工程、及び
現像剤を使用して前記パターンを現像する工程
を具備する、基板上に所定のレジストパターンを作製する方法に使用される前記

ポジ型作用組成物に使用される官能化されたポリマー物質であって、
前記官能化されたポリマー物質は官能基Qを有し、
前記官能化されたポリマー物質は、赤外線照射前は現像剤に不溶性であり、その
後は現像剤可溶性である性質を有し、
前記官能基Qは、二アジ化ナフトキノン基も、二アジ化ベンゾキノン基も具備せ
ず、
前記官能化されたポリマー物質は、官能基Qとは別個の官能基であるジアジド基
を更に有することを特徴とする官能化されたポリマー物質。